DII Program
"Solution Design Phase" SEMINAR

表題：アカデミアにおける人財育成と産学連携に企業が期待する事
日時: 2022年4月22日（金） 16：30−18：00
場所：名古屋大学　IB電子情報館　IB014講義室
講師：足立 正之氏（株式会社堀場製作所 代表取締役社長）
言語：日本語



概要：
私自身の国内外におけるアカデミアやビジネスの経験から、産学連携の価値と意義を議論します。
また、HORIBAグループが世界各地で進めている幾つかの事例を紹介し、それぞれの仕組みや人財育成のスタイルをレビューします。

略歴：
1962年11月1日生　京都市出身

学歴・職歴
1985年 立命館大学 理工学部 数学物理学科 物理課程　卒業
　　株式会社堀場製作所入社
1988年～1990年　カリフォルニア大学アーバイン校燃焼研究所 研究員として米国駐在
1999年　同志社大学工学部 博士（工学）取得
2005年
　～2007年　早稲田大学大学院非常勤講師
2007年
　～2010年　ホリバ・インスツルメンツ社（旧ホリバ・インターナショナル社（米国））社長
2014年
　～2015年　ホリバ・フランス社（旧ホリバ・ジョバンイボン社（仏国））社長
2016年～　ホリバ・フランス社Chairman
2018年～　株式会社場製作所 代表取締役社長 就任、現在に至る

業界団体活動
2014年～　米国自動車技術会 （SAE International） Fellow
2018年～　（公社）日本環境技術協会　会長
2019年5月～（一社）日本分析機器工業会　副会長

※事前申し込み (nishimoto.ichiro.d7@f.mail.nagoya-u.ac.jp)　4/21正午まで